

Rec'd PCT/PTO 15 MAR 2005

PO/DE03/03069

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 10/527850

DE03/03069



REC'D 21 NOV 2003

WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 42 934.0

Anmeldetag: 16. September 2002

Anmelder/Inhaber: SCHOTT GLAS, Mainz/DE

Bezeichnung: Bestimmung der Eignung eines optischen Materials zur Herstellung von optischen Elementen, eine Vorrichtung hierzu und die Verwendung des Materials

IPC: G 01 N 21/64

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 6. Oktober 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Schott

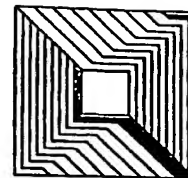
Schott

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

A 8161
06/00
EDV-L

BEST AVAILABLE COPY

PATENTANWÄLTE
FUCHS MEHLER WEISS & FRITZSCHE
WIESBADEN – MÜNCHEN – ALICANTE



European Patent Attorneys
European Trademark Attorneys

Fuchs Mehler Weiß & Fritzsche, Naupliastr. 110, D-81545 München

von/from
Büro/Office München

Dr. Thomas M. Fritzsche
Dipl.-Chem. und Biologe

Naupliastraße 110
D-81545 München
Tel. 089/5 23 17 09
Fax: 089/52 24 05

e-mail: mail@fuchs-patents.com
Internet: www.fuchs-patents.com

Ihr Zeichen/Your Ref.

Unser Zeichen/Our Ref.

Datum/Date

P 1954/PI

102 42 934.0



Büro/Office Wiesbaden

Dr.-Ing. Jürgen H. Fuchs
Dipl.-Ing., B. Com.

Dr. rer. nat. Klaus Mehler
Dipl.-Phys.

Dipl.-Ing. Christian Weiß
Dipl.-Ing. Kurt Müller
Dipl.-Phys. Werner Witzel

Bestimmung der Eignung eines optischen Materials
zur Herstellung von optischen Elementen, eine
Vorrichtung hierzu und die Verwendung des
Materials

SCHOTT GLAS
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
DE

Naupliastraße 110
D-81545 München
Tel. 089/5231709
Fax: 089/522405

Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
Tel. 0611/7142-0
Fax: 0611/7142-20

Hochtechnologiepark
Mikroforum 3
D-55234 Wendelsheim
Tel. 06734-911515

Paseo Explanada de España No. 3. 5-dcha
ES - 03002 Alicante
Telefon: +34/96/5 20 01 34
Telefax: +34/96/5 20 02 48

e-mail: mail@fuchs-patents.com

Internet: www.fuchs-patents.com

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung der Eignung eines optischen Materials für die Herstellung von optischen Elementen, insbesondere zur Durchstrahlung mit energiereichem Licht, bei dem eine strahlungsinduzierte Absorption im optischen Material dadurch ermittelt wird, dass es mit einer Anregungsstrahlung bestrahlt und die durch diese Bestrahlung induzierte aus intrinsischen und nicht-intrinsischen Anteilen bestehende Gesamtfluoreszenz bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass als Fluoreszenz die nicht-intrinsische Fluoreszenz während und/oder unmittelbar nach der Bestrahlung bestimmt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich die intrinsische Fluoreszenz bestimmt und aus dem Verhältnis von intrinsischer zu nicht-intrinsischer Fluoreszenz die Eignung des Materials ermittelt wird.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlung des Materials kurzzeitig erfolgt.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlung mittels eines Laserimpulses erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestimmung der Fluoreszenz mittels einer I-CCD-Kamera erfolgt.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestimmung mittels eines Gitter-Spektrographen erfolgt.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor Bestimmung der Fluoreszenz die Wellenlänge der Anregungsstrahlung mittels einer geeigneten Vorrichtung ausgeblendet wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein Filter und/oder ein Spektralgitter ist.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestimmung der Fluoreszenz innerhalb der Abklingzeit der nicht-intrinsischen Fluoreszenz nach der Bestrahlung des optischen Materials erfolgt.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das optische Material CaF_2 , BaF_2 , SrF_2 , LiF , NaF und/oder KMgF_3 ist.
11. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 - 10, umfassend eine Quelle zur Aussendung einer Strahlengang definierenden Anregungsstrahlung, eine Halterung für eine im Strahlengang angeordnete zu bestimmende Materialprobe, sowie eine außerhalb des Strahlengangs angeordnete Einrichtung zur Bestimmung einer durch die Anregungsstrahlung in der Materialprobe induzierten Fluoreszenz, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Probe und der Ein-

richtung zur Bestimmung der Fluoreszenz ein Sperrelement angeordnet ist, welches den Durchtritt der energiereichen Anregungsstrahlung verhindert.

12. Verwendung des mit dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 10 erhaltenen oder mittels der Vorrichtung nach Anspruch 11 erhaltenen optischen Materials zur Herstellung von Linsen, Prismen, Lichtleitstäben, optischen Fenstern, optischen Komponenten für die DUV-Photolithographie, Steppern, Excimerlasern, Wafern, Computerchips, sowie integrierten Schaltungen und elektronischen Geräten, die solche Schaltungen und Chips enthalten.

Schott Glas
P 1954

TMF/sl/pi/sl

Bestimmung der Eignung eines optischen Materials zur Herstellung von optischen Elementen, eine Vorrichtung hierzu und die Verwendung des Materials

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Eignung eines optischen Materials für die Herstellung von optischen Elementen, eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens sowie die Verwendung der mit dem Verfahren bestimmten optischen Materialien.

Es ist bekannt, dass Materialien, aus denen optische Elemente hergestellt werden, ein sie durchstrahlendes Licht mehr oder weniger absorbieren, so dass die Intensität des Lichts bzw. einer Strahlung nach Durchtritt durch ein optisches Element regelmäßig geringer ist als zuvor. Dabei ist es auch bekannt, dass das Ausmaß dieser Absorption abhängig von der Wellenlänge des Lichtes ist. Für optische Systeme d. h. für optisch transparente Systeme wird jedoch angestrebt, die Absorption möglichst gering zu halten, d.h. diese sollen, zumindest für die jeweilige Arbeitswellenlänge eine hohe Lichtdurchlässigkeit bzw. Transmission aufweisen. Dabei setzt sich die Absorption aus materialspezifischen (intrinsischen) Anteilen und solchen Anteilen zusammen, die auf sog. nicht-intrinsische Anteile, wie z. B. Einschlüsse, Verunreinigung und/oder Kristallfehler, zurückzuführen sind. Während die intrinsische Absorption von der jeweiligen Qualität des Materials unabhängig ist, führt die zusätzliche

Strahlungsabsorption der nicht-intrinsischen Absorption zu einem Qualitätsverlust des optischen Materials.

Sowohl durch die intrinsische als auch durch die nicht-intrinsische Absorption wird Energie im optischen Material deponiert, was zu einer Erwärmung führt. Eine derartige Erwärmung des Materials hat zum Nachteil, dass sich die optischen Eigenschaften z. B. der Brechungsindex ändern, was z. B. in einem zur Strahlformung verwendeten optischen Bauteil zu einer Änderung der Abbildungsverhältnisse führt, da die Brechzahl nicht nur von der Wellenlänge des Lichtes sondern auch von der Temperatur des optischen Materials abhängt. Darüber hinaus führt eine Erwärmung in einem optischen Bauteil auch zu einer Änderung der Linsengeometrie. Diese Phänomene erzeugen eine Änderung des Linsenbrennpunktes, bzw. eine Unschärfe bei mit der erwärmten Linse projizierten Abbildungen. Dies führt insbesondere in der Photolithographie, wie sie zur Herstellung von Computerchips und elektronischen Schaltungen verwendet wird, zu einer Qualitätsverschlechterung bzw. zu einer Erhöhung des Ausschusses und ist somit unerwünscht.

Bei vielen Materialien wird ein Teil der absorbierten Strahlung nicht nur in Wärme umgewandelt, sondern auch in Form von Fluoreszenz wieder abgegeben. Die Ausbildung der Fluoreszenz an optischen Materialien, insbesondere an optischen Kristallen, ist an sich bekannt. So beschreiben beispielsweise W. Triebel et al. in (Proceedings SPIE Vol. 4103, S. 1-11, 2000 Triebel, Bark-Zollmann, Mühlig et al. in „Evaluation of Fused Silica for DUV Laser Applications by Short Time Diagnostics“) die Entstehung und Messung von Laser-induzierter Fluoreszenz (LIF) in Quarz insbesondere in OH-reichem Quarz bzw. einer Glasmatrix. Des weiteren beschrei-

ben M. Mizuguchi et al. in J. Vac. Sci. Technol. A., Vol. 16, Seite 2052 - 3057 (1998) die Ausbildung von optischen Absorptionsbanden in einem Calciumfluorid-Kristall. Des weiteren beschreibt M. Mizuguchi et al. in J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 16, Seite 1153 - 1159, Juli 1999 eine Zeit-aufgelöste Photolumineszenz zur Diagnose des Laserschadens an einem Calciumfluorid-Kristall. Dort wird die Ausbildung von Photolumineszenz bildenden Farbzentren durch Anregung mit einem ArF-Excimer-Laser bei 193 nm beschreiben. Damit derartige Messungen jedoch möglich sind, werden hier Kristalle mit relativ hohen Verunreinigungen verwendet, die den hohen Anforderungen der Photolithographie nicht genügen. Darüber hinaus wird die Fluoreszenzmessung nach einer Wartezeit von 50 nsec. nach Beendigung des Laserimpulses in der zu untersuchenden Probe durchgeführt. Es hat sich nun gezeigt, dass die so erhaltenen Fluoreszenzwerte nicht zur Qualitätskontrolle bzw. zur Bestimmung des Ausmaßes der Verunreinigung, und damit auch zur Ausbildung von Farbzentren in den Kristallen hoher Qualität verwenden lassen.

Es wird daher die Auffassung vertreten, dass sich die Bestimmung der Strahlungs-induzierten Fluoreszenz, insbesondere der Laser-induzierten Fluoreszenz nicht zur Qualitätskontrolle von hochqualitativen optischen Materialien, wie beispielsweise hochreinem Calciumfluorid für die Photolithographie verwenden lässt. (Siehe auch Vortrag Dr. Mann, Laserlabor Göttingen, SPIE Konferenz in Seattle, USA, Juli 2002). Es wurde festgestellt, dass eine Korrelation zwischen der Laser-induzierten Fluoreszenz und einer Aussage über Verunreinigungen bzw. die optische Qualität eines Materials nicht möglich ist.

Die Erfindung hat nun zum Ziel, einen Test bereitzustellen, mit dem ein optisches Material auf seine Eignung zur Verwendung als optisches Element getestet werden kann, und zwar generell für die Verwendung bei bestimmten Arbeitswellenlängen. Dabei soll der Test leicht und ohne großen apparativen Ausbau durchführbar sein. Schließlich soll der Test möglichst untergrundfrei durchführbar sein, d. h. die Ergebnisse sollen möglichst keine Untergrundeffekte enthalten und mit sehr hoher Sensitivität durchführbar sein. Darüber hinaus sollen auch in Kristallen hoher Qualität noch die Störung von nur in geringen Mengen vorliegenden, chemisch nicht mehr oder nur sehr schwer nachweisbaren Verunreinigungen möglichst selektiv bestimmbar und der jeweiligen verunreinigenden Substanz zuordenbar sein.

Außerdem soll mit dem Verfahren die Menge und Art der Verunreinigung ohne aufwändige Kalibrierung an der jeweiligen Probe unabhängig von der Probengröße bestimmbar sein.

Alle diese Ziele werden durch das in den Ansprüchen definierte Verfahren sowie der Vorrichtung erreicht.

Erfindungsgemäß wurde nämlich gefunden, dass sich die zuvor beschriebenen Probleme des Standes der Technik dadurch vermeiden lassen, wenn man die nicht-intrinsische Fluoreszenz bereits während der Anregung mit Licht und/oder unmittelbar nach Beendigung eines Lichtimpulses, d. h. nachdem der Lichtimpuls die Probe durchlaufen hat, ermittelt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass bei den Messungen gemäß dem Stand der Technik die nicht-intrinsischen Fluoreszenzen wegen ihrer kurzen im Nanosekunden-Bereich liegenden Lebensdauer bereits stark abgeklungen sind. Aus diesem Grund enthalten diese Messungen nur noch relativ geringe Fluoreszenzsignale, die

zudem bereits Anteile der intrinsischen Fluoreszenz enthalten.

Dies wird mit dem erfindungsgemäßen Verfahren vermieden und die strahlungsinduzierte Absorption insbesondere die durch Fehler bzw. Verunreinigungen hervorgerufene Absorption kann so auf einfache Weise charakterisiert werden.

In einer erfindungsgemäßen bevorzugten Ausführungsform wird neben der nicht-intrinsischen Fluoreszenz auch die intrinsische Fluoreszenz bestimmt. Da nämlich die intrinsische Fluoreszenz eine Materialkonstante darstellt, lässt sich aus dem Verhältnis von intrinsischer zu nicht-intrinsischer Fluoreszenz rasch ermitteln, ob das getestete optische Material für die Weiterverarbeitung zu einem optischen Element wie beispielsweise einer Linse, Prismen etc. geeignet ist. Darüber hinaus kann aus diesem Verhältnis an Hand einer einfachen Eichkurve jederzeit die Menge der jeweiligen Verunreinigung ermittelt werden, ohne dass aufwändige Kalibrierungen, z. B. Dimensionsbestimmungen etc. an der zu untersuchenden Probe notwendig sind.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es auch möglich, die Eignung eines optischen Materials für jede beliebige Anregungswellenlänge zu testen und zwar bereits vor jeglicher Weiterverarbeitung zu einem optischen Element oder Baustein. So ist es z. B. möglich, die exakte intrinsische Fluoreszenz bei einer Anregungswellenlänge von 193 nm und 157 nm zu bestimmen, und das optische Material je nachdem zur Verwendung für die eine oder die andere Wellenlänge als geeignet zu klassifizieren.

Schließlich ist aus dem Fluoreszenzspektrum die Art der Verunreinigungen auch noch bei Mengen im ppb-Bereich problemlos feststellbar. Aus dem Verhältnis von intrinsischer zu nicht-intrinsischer Fluoreszenz ist ebenfalls die Menge der Fluoreszenz erzeugenden Verunreinigung ermittelbar. Übliche verunreinigende Materialien sind Seltene Erden und insbesondere Cer, Europium, Terbium, Natrium und auch oxidischer Sauerstoff.

Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, das Bestimmungsverfahren mit UV-Licht und insbesondere tiefem UV-Licht durchzuführen. Dabei haben sich Wellenlängen unterhalb 250 nm, insbesondere unterhalb 200 nm als zweckmäßig erwiesen, wobei Wellenlängen zwischen 100 bzw. 150 nm und 200 nm besonders bevorzugt sind. Zweckmäßigerweise wird das Verfahren mit derjenigen Anregungswellenlänge durchgeführt, mit der das optische Material beim späteren Gebrauch durchstrahlt werden soll. Eine bevorzugte Strahlungsquelle für das energiereiche Licht ist ein Laser, wobei Laserimpulse mit Arbeitswellenlängen von 193 und/oder 157 nm bevorzugt sind.

Im erfindungsgemäßen Verfahren wird die nicht-intrinsische Fluoreszenz vorzugsweise mittels einem Gitterspektrograph und einer I-CCD-Kamera mit einstellbaren Belichtungsintervallen (Intensified charged coupled device) gemessen, wobei es bevorzugt ist das dabei erhaltene Spektrum rechnergesteuert zu verarbeiten. Derartige Messungen und Vorrichtungen sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise von W. Triebel et al. in Proceedings SPIE Vol. 4103, S. 1-11, 2000, „Evaluation of Fused Silica for DUV Laser Applications by Short Time Diagnostics“) oder auch von Mizuguchi et al. in J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 16 f. 53 ff. (Juli 1999) beschrieben.

Erfindungsgemäß ist es besonders bevorzugt, zwischen der zu untersuchenden, fluoreszierenden Probe und der Fluoreszenz-Meßeinrichtung eine Sperreinrichtung anzuordnen, welche den Durchtritt der üblicherweise energiereichen Anregungsstrahlung verhindert. Derartige Sperreinrichtungen, die beliebige Anregungswellenlängen ausblenden sind dem Fachmann bekannt. Die Ausblendung kann dabei auf vielfältige Art und Weise erfolgen. Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Ausblendung dieser Wellenlängen mittels einem vor der CCD-Kamera angeordneten Gitterspektrographen, welcher das aufgenommene Licht in seine verschiedenen Wellenlängen aufteilt. Durch entsprechende Anordnung bzw. Drehung des Spektrographen ist es möglich, die von einer energiereichen Strahlungsquelle ausgesonderte Anregungsstrahlung abzublocken oder abzulenken. Prinzipiell ist es auch möglich, den Gitterspektrographen der CCD-Kamera selbst zu drehen.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung von wellenlängenspezifischen Filtern wie z. B. dielektrischen Dünnschichtfiltern, die heute ebenfalls selektiv für beliebige Wellenlängen herstellbar sind. Derartige Filter werden üblicherweise dadurch hergestellt, dass auf ein Trägermaterial eine entsprechende mehrschichtige Spiegelschicht aufgetragen wird, welche den Durchtritt der unerwünschten Wellenlängen verhindert.

Solche Schichtenfilter sind im erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugt. Es ist jedoch notwendig, dass die verwendeten Filter keine durch das auftreffende Licht erzeugte Eigenfluoreszenz aufweisen, damit die Meßergebnisse nicht verfälscht werden.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es nunmehr auch möglich Fluoreszenzen zu bestimmen, deren Wellenlängen nahe der Anregungswellenlänge liegen. Dies ist für die Verwendung von optischen Elementen in der Photolithographie von besonderer Bedeutung, da die Energie derartiger Fluoreszenzwellenlängen ebenfalls ausreicht den Photolack eines Wafers zu belichten, was zu einem starken Kontrastverlust des auf den Wafer projizierten Schaltmusters führt.

Die erfindungsgemäße Bestimmung der Fluoreszenz erfolgt insbesondere innerhalb bzw. unmittelbar nach einem Belichtungsintervall am Material. Sie erfolgt vorzugsweise innerhalb eines Zeitabschnitts nach Ende der Materialbelichtung, der den jeweiligen charakteristischen Abklingkurven bzw. Lebensdauern der verschiedenen nicht-intrinsischen Fluoreszenzen entspricht bzw. daran angepasst ist. In einer Vielzahl von Fällen haben sich 90%, insbesondere 80%, oft auch 70% der Abklingzeit zur Messung als zweckmässig erwiesen. Bei einigen, bevorzugten optischen Materialien wird das erfindungsgemäße Verfahren bzw. die Bestimmung innerhalb eines Zeitraumes bzw. Zeitabschnittes von weniger als 50 nsec. nach Beendigung der Bestrahlung bzw. des Bestrahlungsimpulses im Material durchgeführt, wobei die Bestimmungen bis zu max. 40 vorzugsweise bis zu max. 30 nsec. besonders bevorzugt sind. In einigen Fällen haben sich sogar Messungen innerhalb einer Zeit von weniger als 15 nsec als zweckmässig erwiesen, nachdem der Strahlungsimpuls das Material durchlaufen hat.

Von den im erfindungsgemäßen Verfahren verwendeten CCD-Kameras sind sogenannte OMAS (Optical Multichannel Analyzer bzw. intensivierete optische Vielkanalanalysatoren) insbesondere mit einstellbaren Belichtungs- bzw. Messintervallen bevorzugt. Eine derartige Kamera weist eine Nachweisgrenze von

weniger als 10 Photonen auf und ermöglicht so geringe Belichtungszeiten wie beispielsweise 10 nsec. bzw. sogar bis zu 150 psec. Derartige Kameras sind unter anderem beispielsweise von Roper Scientific, USA kommerziell erhältlich.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist für beliebige optische Materialien geeignet, die unter Bestrahlung eine Fluoreszenz entwickeln, wobei jedoch kristallines optisches Material insbesondere halogenidische bzw. fluoridische Einkristalle bevorzugt sind. Besonders bevorzugt sind Alkali- und/oder Erdalkalifluoride, wobei Kalziumfluorid, Bariumfluorid, Strontiumfluorid, Lithiumfluorid, Kaliumfluorid und/oder Natriumfluorid sowie Mischung wie z. B. KMgF_3 ganz besonders bevorzugt sind.

Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Durchführung eines besonders bevorzugten erfindungsgemäßen Verfahrens. Eine solche Vorrichtung umfasst eine Strahlungsquelle zur Aussendung einer Anregungsstrahlung, einer Probenhalterung zur Aufnahme einer zu bestimmenden Materialprobe, sowie eine Einrichtung zur Bestimmung einer durch die Anregungsstrahlung in der Materialprobe induzierten Fluoreszenz. Die Anregungsstrahlung verläuft entlang eines üblicherweise linearen Strahlungsganges ausgehend der von der Strahlungsquelle durch die Materialprobe und mündet vorzugsweise in einer Referenz-Photodiode. Erfindungsgemäß ist die Fluoreszenzbestimmungseinrichtung außerhalb dieses Strahlenganges angeordnet, sodass keine Anregungsstrahlung direkt in die Fluoreszenzbestimmungseinrichtung treffen kann. Vorzugsweise ist dabei die Einrichtung so angeordnet, dass die zu messende Fluoreszenz einen Fluoreszenzstrahlengang beschreibt, der senkrecht zum Anregungsstrahlengang verläuft. Die Fluoreszenz-Meßeinrichtung umfasst üblicherweise eine oder mehrere

optische Linsen, welche die von der zu untersuchenden Materialprobe ausgestrahlte Fluoreszenz in einem Polychromator bzw. einem Gitterspektrographen bündeln. Das im Spektrographen in seine einzelnen Wellenlängen zerlegte Fluoreszenzlicht wird dann auf eine CCD-Kamera, insbesondere I-CCD, gelenkt, in welcher die Intensität der einzelnen Wellenlängen bestimmt und vorzugsweise mittels einem Rechner bzw. einer Datenverarbeitungsanlage verarbeitet und speichert. Die so mittels der CCD-Kamera bestimmten und gespeicherten Fluoreszenzpunkte können nun auf einfache Weise im Rechner mit gespeicherten Standardwerten verglichen und bestimmt werden.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet sich nun dadurch aus, dass zwischen der zu testenden Materialprobe und der CCD-Kamera ein Sperrelement angeordnet ist, welches den Durchtritt der energiereichen Anregungsstrahlung zur CCD-Kamera verhindert. Durch das in der erfindungsgemäßen Anordnung vorliegende Sperrelement wird sichergestellt, dass kein Licht der Strahlenquelle in die CCD-Kamera gelangt. Dieses Sperrelement verhindert auch, dass Streulicht der Anregungsstrahlung in die CCD-Kamera gelangt und dabei nicht nur die Messung verfälschen sondern diese hochempfindliche Kamera auch zerstören kann. Dabei soll das erfindungsgemäß verwendete Sperrelement bei den Anregungswellenlängen nicht selbst fluoreszieren, und dadurch gemessene Fluoreszenzwerte verfälschen.

Als Sperrelement sind sämtliche Vorrichtungen geeignet, welche eine bestimmte Wellenlänge ablenken, reflektieren oder absorbieren. Eine einfachste Ausführung ist beispielsweise ein optisches Gitter, wie dies im Polychromator bzw. Spektrographen selbst vorliegt. In einer weiteren erfindungsgemäß bevorzugten Ausführungsform umfasst das Sperrelement ei-

nen wellenspezifischen Filter, insbesondere einen Mehrschichtenfilter, bei dem eine Doppelschicht oder mehrere Spiegelschichten aufgetragen sind, welche die jeweilige Wellenlänge auslöschen oder reflektieren. Ein besonders bevorzugter Filter ist ein dielektrischer Dünnschichtfilter.

Es hat sich gezeigt, dass es mit derartigen Filtern möglich ist, auch Fluoreszenzen zu bestimmen, welche nahe der Anregungswellenlänge auftreten. Derartige Fluoreszenzen sind insbesondere bei der Photolithographie fatal, da diese aufgrund ihrer Nähe zur Anregungswellenlänge genau so wie diese einen Photolack belichten können und damit die Schärfe bzw. den Kontrast eines aufprojizierten Schaltungsmusters merklich verringern können.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es daher möglich, bei der Herstellung von optischen Vorrichtungen nicht nur frühzeitig diejenigen optischen Materialien von der Weiterbearbeitung auszuschließen, welche eine hohe nicht-intrinsische Fluoreszenz aufweisen, sondern auch diejenigen, die eine Fluoreszenz nahe der Anregungswellenlänge zeigen.

Die erfindungsgemäß bestimmten optischen Materialien eignen sich besonders zur Herstellung von optischen Komponenten in der DUV-Lithographie, sowie zur Herstellung von mit Photolack beschichteten Wafern und somit zur Herstellung von elektronischen Geräten. Die Erfindung betrifft daher auch die Verwendung der mittels dem erfindungsgemäßen Verfahren und/oder in der erfindungsgemäßen Vorrichtung erhaltenen Materialien zur Herstellung von Linsen, Prismen, Lichtleitstäben, optischen Fenstern sowie optischen Geräten für die DUV-Lithographie, insbesondere zur Herstellung von Steppern und Excimerlasern und somit auch zur Herstellung von

integrierten Schaltungen, Computerchips sowie elektronischer Geräte wie Computern sowie anderer Geräte, welche chipartige integrierte Schaltungen enthalten.

Schott Glas

TMF/pi/

P 1954

Bestimmung der Eignung eines optischen Materials zur Herstellung von optischen Elementen, eine Vorrichtung hierzu und die Verwendung des Materials

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Eignung eines optischen Materials für die Herstellung von optischen Elementen, insbesondere zur Durchstrahlung mit energiereichem Licht, bei dem eine strahlungsinduzierte Absorption im optischen Material dadurch ermittelt wird, dass es mit einer Anregungsstrahlung bestrahlt und die durch diese Bestrahlung induzierte aus intrinsischen und nicht-intrinsischen Anteilen bestehende Gesamtfluoreszenz bestimmt wird, wobei als Fluoreszenz die nicht-intrinsische Fluoreszenz während und/oder unmittelbar nach der Bestrahlung bestimmt wird, sowie eine Vorrichtung hierzu und die Verwendung des so getesteten Materials.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.